

電気学会研究会資料目次

光応用・視覚研究会

[委員長] 高橋信一 (慶応義塾大学)

[幹事] 篠田之孝 (日本大学), 本田久司 (東芝ライテック)

日 時 平成18年3月3日 (金) 13:00～17:20

場 所 電気学会第1～3会議室 (東京都千代田区五番町6-2, HOMAT HORIZON ビル8階, JR中央線 (各駅停車) 市ヶ谷駅下車, 営団地下鉄有楽町線・南北線, 都営地下鉄新宿線市ヶ谷駅下車, 3番出口より徒歩2分, Tel: 03-3221-7313, 場所の詳細は, 次のURLをご参照ください。 <http://www.iee.or.jp/honbu/map.pdf>)

テーマ「液浸リソグラフィ技術と EUV リソグラフィ技術」

- LAV-06-1 低 k1 リソグラフィ技術
笠間邦彦 (NEC エレクトロニクス) …… 1
- LAV-06-2 ArF 液浸露光装置の開発状況
小林正道, 中野一志, 荒川三喜男 (キヤノン) …… 7
- LAV-06-3 液浸リソグラフィ
龜山雅臣 (ニコン) …… 13
- LAV-06-4 高屈折率液浸材料開発
稗田克彦, Yong Wang (JSR) …… 17
- LAV-06-5 EUV 露光装置技術の開発の現状
福田恵明 (技術研究組合極端紫外線露光システム技術開発機構) …… 21
- LAV-06-6 低分子 EUV レジストの開発
塩野大寿, 平山 拓, 羽田英夫, 小野寺純一 (東京応化工業)
新井 唯, 山口敦子, 小島恭子, 白石 洋, 福田 宏 (日立製作所)
老泉博昭, 西山岩男 (ASET) …… 25

LAV-06-7 EUV 多層膜用キャッピングレイヤの開発

松成秀一, 青木貴史, 村上勝彦, 寺島 茂, 高瀬博光, 五明由夫 (EUVA)

角谷幸信, 新部正人 (兵庫県立大学) …………… 29

協 賛 リソグラフィ先端技術調査専門委員会